

開催案内

マンスリーセミナー

405	2/21 (火)	レーザプリンタ用VCSELアレイと VCSELの応用	株式会社リコー リコー未来技術研究所 技師長 佐藤 俊一 氏
<p>(内容) 面発光レーザは、低消費電力、二次元アレイ化が可能、LED 並みの簡単なプロセスで高性能化が可能、ウェハ単位での性能試験が可能であるなど、従来の端面発光型半導体レーザに比べて多くの利点がある。本講演ではこのような特徴を生かして、デジタル商業印刷分野に適用できるプリンタの書き込み光源として開発した面発光レーザアレイについて報告する。単一方向偏光制御と大きなシングルモード出力を達成し、4800 dpi の高精細で 150 ppm の高速印刷可能な光源を実現した。また、センサー応用や高出力 VCSEL アレイ化などリコーにおける VCSEL 応用や、市場動向についても紹介する。</p>			
406	3/21 (火)	短パルスレーザープロセッシングによる 材料内部構造改質とその応用	京都大学大学院 工学研究科 材料化学専攻 教授 三浦 清貴 氏
<p>(内容) 本講演では、ピコ秒あるいはフェムト秒レーザーによる材料の内部プロセッシングについて、ポンプ-プローブ法により得られた知見をもとにその特徴と構造改質メカニズムについて概説し、無機ガラス、酸化物単結晶、高分子や半導体材料等における内部構造改質および液相レーザーアブレーションによる金属ナノ粒子やナノダイヤモンドの作製とそれらの応用について紹介する。加えて、材料内部を高速・高精度で加工(改質)する手法のひとつである空間位相変調器を利用したホログラフィック三次元加工についても紹介する予定である。</p>			
407	4/18 (火)	シリコンフォトニクス技術を用いた ボード間/LSI間超小型光トランシーバ	技術研究組合 光電子融合基盤技術研究所 研究統括部長 中村 隆宏 氏
<p>(内容) シリコンフォトニクスは、シリコンの高屈折率差による強い光閉じ込めにより小型・低消費電力化が期待されること、並びに、LSI-CMOS ラインを用いて製造可能で、低コスト化が期待されることで、光トランシーバへの導入が進められている。本講演では、これらのシリコンフォトニクスの利点と実装技術により超小型化した光トランシーバである光 I/O コアについて報告する。また、光 I/O コアの応用先の 1 つであるボード間/LSI 間への適用に関しても紹介する。</p>			

最新情報は光産業技術振興協会のマンスリーセミナーのページをご覧ください。

会場：光産業技術振興協会（有楽町線 江戸川橋駅 3 番出口）
東京都文京区関口 1-20-10 住友江戸川橋駅前ビル 7 階
時間：午後 3 時 30 分～5 時 30 分
定員：60 名（申込先着順）
<http://www.oitda.or.jp/main/monthly-j.html>

参加料：協会賛助会員：1,500 円（1 回につき・消費税込）
一般参加：3,000 円（1 回につき・消費税込）
申込先：光産業技術振興協会 開発部 間瀬
TEL：(03)5225-6431 FAX：(03)5225-6435
E-mail：mly@oitda.or.jp